This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LIPPEDIMAGE= JP403036527A

PAT-NO: JP403036527A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03036527 A

TITLE: OPTICAL ELEMENT

PUBN-DATE: February 18, 1991

INVENTOR-INFORMATION: NAME KAWANISHI, YUJI ICHIMURA, KUNIHIRO SEKI, TAKAHIRO TAMAOKI, TAKASHI IKEDA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

N/A

APPL-NO: JP01171627

APPL-DATE: July 3, 1989

INT-CL (IPC): G02F001/135;G02F001/1337;G02F001/1337

US-CL-CURRENT: 349/FOR.124,349/158

ABSTRACT:

PURPOSE: To obviate the degradation in image resolution with time by laminating a high-polymer compd. layer which is reversibly changed in structure by light and a liquid crystal layer.

CONSTITUTION: The high-polymer compd. having the residual group which is reversibly changed in structure by light is naturally adsorbed on a transparent substrate 1 to provide the thin film 2; further, the liquid crystal layer 3 is laminated thereon. The high-polymer compd. which is reversibly changed in structure by light is naturally adsorbed on the substrate and the high-polymer adsorbed thin film is eventually formed if the liquid crystal dissolved or dispersed with such high-polymer compd. is introduced into the substrate. The arrangement of the liquid crystal layer is rapidly transmitted even if the arrangement is the overlaps of the molecules of ≥10,000 times the compd. when the liquid crystal layer in contact with the thin film is reversibly

arranged parallel or perpendicular according to the reversible change in the structure of the residual group in the thin film by the light. The liquid crystal layer does not change in this way unless the state of the light changes. The information is thus maintained over a long period of time.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio





⑮日本国特許庁(JP)

D 特許出頭公開

@公開特許公報(A)

平3-36527

®Int. Ci. 3 G 02 F 1/135

識別記号 庁内整理番号

5 2 0

❸公開 平成3年(1991)2月18日

1/1337

8806-2H 8806-2H 8806-2H

審查請求 有 請求項の数 3 (全7頁)

会発明の名称 光学素子

> 平1-171627 20符 90

@出 頤 平1(1989)7月3日

⑫発 明 者 Ш 西 祐 司 茨城県つくば市吾妻 2丁目710棟107号 個発 明 者 市 村 玉 宏 茨城県つくば市松代5丁目630枚2号 仓発 明 者 関 隆 広 茨城県つくば市吾婆2丁目805棟605号 @発 明 者 玉 敬 茨城県北相馬郡守谷町みずき野 1 -11-9

⑫発 明 者 池 . **B** 茨城県つくば市和台46番地 三菱製紙株式会社気波研究所 光 弘.

内

勿出 顧 X 工業技術院長

東京都千代田区麓が関1丁目3番1号

②指定代理人 工業技術院繊維高分子材料研究所長

1. 発明の名称

光学素子

2. 特許請求の範囲

- (1) 週明基板上に、光により可逆的に横及変化 を起こす高分子化合物層と波晶層とを、 その原序 に限層して成る光学衰子。
- (2) 透明基板上に、被晶物質と光により可逆的 な構造変化を起こす高分子化合物との混合物を塗 むし、所用時間放置することを特徴とする額求項 (1) 記載の光学素子の莨造方法。.....
- (3) 週明基板上に、光により可逆的な領遊変化 を起こす高分子化合物を塗布し、 さらにその上に 被品物質を独布した後加熱・冷却することを特徴 とする需求項(1) 記収の先学君子の製造方法。

3. 注明の非額な設別

政策上の利用分野

本発明は、先による波基の配向変化を利用した 新規な光学選子に関するものである。 さらに辞し くいえば、本類明は光により可逆的に調査変化を 起こす疫苗を有する高分子化合物の溶点を液晶か らの自然衰裂という方法により形成し。 この作用 により披星型の配所変化を生じさせ、 それを利用 して僧種を一助的又は永久的に記録する光学弟子 に関するものである。

従来の技術

被品を用いる光学漢子としては、 情報をな気的 な冷用を判別して貯蔵するものと、 光の作用を料 用して貯蔵するものとが知られており、 資資は主 として設示用に料用され、後身は光記録へ応用さ れた何がある。

每周平3-35527(2)

ところで、電気的な作用を利用して情報を書き込む減温患学療子は、電力の保給が停止すると情報が需失するため、これを永久的に保存するには、特別の工夫を加えなければならないし、またパターン化された電極を用いるため解像性が低く賞客量の光学素子としては不適当である。

不明確になる(1986年月以化学会第52市際 年会講談子孫集章庫)。

我们が解決しようとする課題

本発明は、光による数品の配置変化を割用する 光学選子であって、しかもその複数性に起因する 解像性の疑判的低下をもたらさない多色光学選子 を提供することを見めとしてなされたものである。

課題を解決するための手段

本発明者らは、光による故品の配向変化を利用した光学素子を関発するために、奴違原究を或ねた結果、光により可逆的に構造変化を起こす残なを打する高分子化合物を溶解あるいは分散した故品を基板上へ導入すると、これら高分子化合物が基板へ自然吸着する結果、高分子吸煙解膜が形成され、薄膜中の残基の光による可逆的な構造変化に応じて、頻繁に接する数品層が可逆的に平行(

パラレルまたはホモジニアス)配列又は垂直(ホメオトロピック)配列すること、この液晶度の配列は上記化合物の1万倍以上の分子の成なりであっても迅速に伝達されること、したがって先の状態が変化しない限り液晶層は変化せず及短期にわたって情報が保持されることを見いだし、この知見に基づいて本発明をなすに至った。

すなわち本発明は、(1) 選明基投上に光により可逆的に構造紙化を起こす百分子化合物層と被暴層と表。その順序に模層して成る光学素子。(2) 選明基接上に該品物質と光により可逆的な可逆的な設定することを特散でする上記(1)の光学素子の製造方法、(3) 選明基接上に光になり可逆的な構造変化を起こす高分子化合物とのより可逆的な構造を検査を検索をした。ならにその上に被暴物質を検索した後、加熱・冷却することを特徴とするものである。

本発明における透明基板としては、普通のシリカガラス、破質ガラス、石英、各種プラスチック

などのシートあるいはその表面に、 酸化ケイ素、 酸化スズ、酸化インジウム、酸化アルミニウム、 酸化チタン、酸化クロム、酸化延纶などの違風酸 化物や氧化ケイ素以化ケイ素などの被要を有する ものが用いられる。 さらには、公知の方法により これらを異思媒性化合物。シリル化解などの表面 婚項別によってあらかじめ処理を放してもよい。

通常、波晶は2枚の基板の間に充壌されたサンドイッチ視点体として用いられるが、本発明においては、この2枚の基板のうちの少なくとも一方が透明基板であればよく、位方は網、鉄、アルミニウム、白金などの全域のシート又はこれらの金属で装板したシートにすることもできる。これらの基板は過常0、01~1mmの形みの共通平滑なシートとして用いられる。

本見所においては、上記の基板上に先により可逆的に関連変化を起こす残益を有する百分子吸煙障礙を設けることが必要であるが、この残益を構成する化合物としては、ホトクロミック化合物が最も登録に用いられる。

預期平3-36527(3)

このホトクロミック化合物とは、 光の作用では 政変化を生じ、その光に対する単数例えば白調を 変化する化合物であって、これまで炭素=炭素原 投票・資素期、窒素・窒素期の不飽和二度結合の 光幾何異性化反応、原子資光異性化反応、ヘテロ リテイックな光閉間度反応、光閉環反応、光互変 異性化反応などを利用した多種多様の化合物が知 られている。【例えばワイリーインターサイエン ス社発行、ジー、エイチ、ブラウン型、「ホトゥ ロミズム」(1971年) 春風〕。 このような化 合物のうち、光幾何異性化に基づくホトクロミッ ク化合物の例としては、アゾベンゼン、インジゴ、 アシルインジゴ、チオインジゴ、セレノインジゴ、 ペリナフトインジゴ、ヘミインジゴ、ヘミチオイ ンジゴ、アゾメチンなどを、ヘテロリティックな 光関閉環反応に基づくホトクロミック化合物の例 としては、インドリノスピロベンゾピラン、イン ドリノスピロナフトオキサジン、ペンゾチアゾリ ノスピロベンゾピラン、インドリノスピロベンゾ チオピラン、スピロインドリジンなどを、 光図環

及応に基づくホトクロミック化合物の例としては、スチルベン、フルギドなど、をまた光互要異性化反応に基づくホトクロミック化合物の例としては、サリチリデンアニル、ローヒドロキシアゾベンゼン、ローニトロベンジルなどをそれぞれ基本分格とする化合物を挙げることができる。

本規則において用いられるこのようなホトクロクロクな残据をもつ高分子は、あらかじめられてかっているかられてなって、カウル位を有する甲点体を製造してからまっての反応に供して気速してもよいて、日本には、「1984年)を配り、「この残と応用」(1984年)を配り、「このみなどは高分子の主象によって、は温に結合しているのでは、まトクロミック残器は増設に結合している方がより任ましい。

本見明に用いられるホトクロミック残益を有す る高分子を与える基件高分子としては、ポリビニ

ルアルコール、ポリイミギ 樹脂、ポリ(メタ)アクリル段エステル、ポリ(メタ)アクリル酸アミド、ポリ(L-リジン)、ポリ(L-リジン)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリシロキサン、ポリスルホンなどをあげることができるが、これに限定されるものではない。

理する。などの方法をとることもできる。

これらの基件資分子へのホトクロミック単位の 選入率はホトクロミック単位1つあたりの分子量 がホトクロミック単位を放した値に換算して0から 500までの範囲になるように数定することが望まし い。これ以上の値、 置いかえるならば、これ以下 の低い導入率では波昌の可逆的配向変化が認めら れなくなる。

本見明にかかわる「特許請求の範囲」の事項 (1) に記載の光学選子を預定するには、

方法①(特許簡求の短頭史製の専項 (2)):

高分子を特殊。または分数した数品を直接基板 上へ導入し、所定均割放置する(次数例 1。 2。 4)。

あるいは.

方法(型(特許請求の解語型級の客項 (3)): 高分子を含む禁道の遊送堕布がスピン流句によ

特周平3-36527(4)

って、 基板上に高分子層を形成した後に対益を導入し、 これを一旦加熱後、冷却する (火焰男3 中風)。

といった資品中からの自然吸糞による方法が用いられる。方法②における知無温度は用いた百分子。被品あるいは延板の程順などによって異なるが、おおむね50~150°Cの間の被品相/アイソトロピック和報移温度付近が好ましい。これより極端に高い温度であれば、用いた高分子・被品・延板などの分解や破裂につながり好ましくない。またこれより低い温度では、液晶中への高分子の溶解度が低く有効な高分子吸力解膜が形成されにくく好ましくない。

また、この高分子吸着類裏の厚みは単分子がで も本発明の目的に合和するものであり、数μmか ら致10Åのいかなる範囲でも差しつかえがない。 従って、あらかじめ高分子を含む波晶からの吸着 による方法①の場合には、波晶中の高分子の濃度 は吸着時に上記の範囲の厚みを提供できるもので

次に、光により可逆的に構変変化を起こす高分子級者が製上に設ける被基層の被基としては、従来知られているネマティック系、スメクティック系及びコレステリック系の被最物質の中から任意のものを選ぶことができるが、スメクティック系被最初質の場合は、ある温度でネマティックは温度をとるものを選ぶ必要がある。また、被品物質としては低分子のみならず百分子のものも含まれることは含うまでもない。

このような波品物質は、例えばエー・ペキン(A。Bequin)他著、「モレキュラー・クリスタルズ・アンド・リキッド・クリスタルズ(Molecular crystals and liquid Crystals)」、第115 徒、第1ページに記載されている。高分子性波晶物質は、たとえば、アドバンシズ・イン・ポリマー・サイエンス(Advances in Polymer Science)、第60/61巻(1984)に興級されている。これらの波品物質は、単独で用いてもよいし、また2種以上品合

あれば良い。具体的には疑問・数分子・基础の代質などに数でする。基金上にあらかじめ高分子度を用点する方法のの場合。用点する高分子度の深みは吸煙時に上記の管理の原みを提供できる過度の高分子を設置中に与えるものであれば良い。具体的には被罰・高分子・基板の住實。セルの意みなどに数存する。

支品の可逆的配例交化によって明故な記憶数を持るためには、这品分子の長輪が一方向に向いた出モジニアス配向をとることが望ましい。このためには、ホトクロミック浸版を持つ古分子が受罪した透明基板に異方性を付与することが必要となる。これには、あらかじめ透明させたり、あるかじは、ラビング発度をほどこして表面を提出されば、あらかじめこれをラビングを見または延伸を理するか。ホトクロミックを必要をもつ百分子で要要はを形成したのち延伸を見することもできる。

して用いてもよい.

次に適付図面により本発明をさらに辞報に説明する。

第1回は本発明の基本構立を示す所面図で透明 基板1の上に、光により可逆的な構立変化を見ま 支援基を有する百分子化合物を自然被殺して対理 2を設け、さらにこの上に被益短3を疑照する。 として放散や機関を防ぐために、この上をさらに 基板型している。この基板は透明であっても ま板であっても良く、その表面に光により可能 のは変化を起こする分子化合物が自然機可に対 のなりを用いることもできるし、液温を表面に でに配列する作用をもつれてジニアス配列層で被 取したものを用いることもできる。

第2回は、本売明の肝道な実施周辺の例を示す 販面図であって、これは表面上にホトクロミック 飛基を有する高分子吸収深度2を設けた2枚のな 板1の時に、波温度を挟んだサンドイッチ構造を 有している。

そして、この図の1は光照射前、1は光照射板

特牌平3-36527(5)

次に第3回は、第2回の場合とは別の実施階級の例であり、2枚の基板のうちの一方のホモジニアス配向層4が数けられている例である。このホモジニアス配向層は、基板表面をポリビニルアルコール、ポリイミド樹脂、ポリオキシエチレンな

とでラピング処理したり、あるいはSiO。のような酸化物を斜め方向から蒸却することによりなけることができる。この例においては、ホトクロミック機及を持つ百分子装置複数ではおいては、新3回1に示すように被量はある表面の原理では、新に配列しているが、ホモジニアス配向原理ではある。そして、これに光照射すると、その思封されたかか(人)においては被当はホトクロミック不知面に配列するので、全体がホモジニアス配列状態となり、前記と同葉にして超光により光析機を観み出すことができる。

本発明の光学素子において、いったん記録した 情報を消去したい場合は、記録時に使用した光と 彼長の異なる光を煎射して、ホトクロミック化合 物の構造を元に戻すことにより行うことができる。

被温度の中にあらかじめ二色性色斑を溶解させておくことにより、 質光板を用いることなく、 色素の顕派によって情報を読み出すことも可能である。

二色性色素としては、例えば、松村尚柔、「集色工業」、第32章、215ページ(1984) に記載されているものが用いられる。

この場合、温度依存性のある液晶物質例えば玄 温においては、光を照射しても構造変化を起こさ ないが、ある温度以上に加熱すると光照射により 構造変化を起こす波晶物質を用いれば、二色性色 素の漏液に基づく低久的な記録を得ることができる。

発明の効果

本発明の光学業子は、従来のホトクロミック材料による情報記録の欠点、 例えばいったん 記録させた情報が飲み取りの繰り返しにより体々に消失するという欠点を示さないという利点がある上に、波晶の配列がホトクロミック高分子吸資滞認によって体せられるので、 波動性を持つ 波晶による 解性は、 従来のホトクロミック化合物 を波晶に加えたものを用いる場合よりもはるかに優れている.

また、本発明の光記録謝子は、可逆的な光情報 酸に用いられるだけでなく、光アドレス型の表示 にも針波に用いることができる。

さらに本発明では、数温の配列を作する質分子 海膜の形域に於て被温から延振表面への自然吸着 という方法を用いているため、用意された被温セ ル中へ質分子を含む被温を対入するという非常に 簡型な方法で光学素子としての液温セルが気道で きるが、これは本発明により初めて達成された技 物であり産業上に於ける質値が大変さい。

火焰例

次に実施例により本発明をさらに群類に説明する。

(実施例1)

常法により合成した4-メタクリロイルオキシアソペンゼンを、ペンゼンを224、2、21-ア

特別下3-36527(8)

ソピス(イソプチロニトリル)を開始派とし収配 異条作下でラジカル 焦合して。 ホトクロミック技 4としてアゾベンゼン単位を持つな分子(1)を **行た。この真分子(1)1mgモシクロヘキシル** カルポン難フェニルエステル系ネマティック波品 (DON103, ロディック社類) 100ml it へ100° Cで加熱溶解し、常以へ冷却後不溶物 を載去した。 レシチン(東京化成員)の20%ト ルエン溶液を600回転/分の条件下でスピンコ ートしたガラスは仮2枚に、この高分子(1)/ 波晶混合物を8μmのガラスロッドスペーサーを 介して挟み液晶セルとした。このようにして母ら れたセル中の被暴配向は垂直配向であり、盗交す る個光子時にこれを置き観察するとき全く光は透 過されず。明い画像を与えた。このセルに水銀灯 をフィルターカットして得られる365ナノメー トルの常外光を照射するとアゾベンゼン単位のト ランスからシスへの光異性化が朗起されるが。こ れにともなって被基の水平配向への配向変化が行 われ、複風折が変化する結果、直交する個光子間

にこれを置くとき、光を透過し、明るい所数を与えるようになった。疑いてこのセルに、同じく未想灯をフィルターカットして得られる440ナノメートル以上の可観光を原射すると、アゾベンゼンの位のシスからトランスへの光質性化が舒起され、これにともない被量は再び到面包別へと配別変化し、呼び観光を透過しなくなった。この情外光/可観光の交互別針に伴う可逆的な波量配向変化は、何回も繰り返し可能であった。

(災庭例2)

常法により合及したイーメタクリロイルアミノアゾベンゼンを、アセトンを常様、 2、 2 ・ ーアゾピス (イソブチロニトリル) を関始所とし収成財条件下でラジカル重合してホトクロミック投場としてアゾベンゼン単位を持つ百分子 (2) を得た。 実施例1と同様に関値した高分子 (2) / 注量の合物を、 な法により n ーオクタデシルトリクロシランで表面処理したガラス基板 2 枚に 8 μ m のガラスロッドスペーサーを介して換み込み、

被品セルとした。 この様にして作られた被品セル は、実施例1に述べたと同様の光照射下の広答を 示した。

(炎监例3)

実施例2の高分子(2)の1%ジオキサン溶液をガラス基板にスピンコートし、このガラス基板でシアノビフェニル系液晶(RO-571、ロディック社関)を8μmのスペーサーを介して快みせルとした。このセル中の液晶配向は水平配向でありこのままでは光応答を示さない。しかし、このセルを液晶相一等方相転移点付近で30分下ニールした後室温に戻すと、液晶中に溶解した高分子(2)の吸着輝度が基板上に形成され、突旋例1に述べたと同様の光度射下の応答を示すようになった。

(突旋例4)

重合度500の完全けん化ポリピニルアルコール。及び常弦により合成した4~(4~ヘキシル

フェニルアソ) フェノキシアセチルクロライドとをジメチルフォルムアミドーペンゼン混合部原中で数時間知然し、約30%アゾベンゼン単位が導入されたポリビニルアルコール (3) を得た。実施例1と同様に顕質した高分子 (3) / DON1 03被基础合物を、洗浄した未処理のガラス基板に8μmのスペーサーを介して挟み、セルとした。この景にして作られた波量セルは、実施例1に述べたと同様の先照射下の応答を示した。

4. 図面の簡単な説明

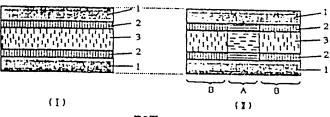
第1図・第2図・第3図は、本発明の光学界子の販面図である。第1図は本光学界子の基本的な調査を示す断面図である。第2図は本光学表子の実施形態の一例であって、図巾それぞれ(I)光型射的。(II)光型射色の、波晶の配列状態の変化を示している。第3回は別の実施形態の例であって(I)光型射的、(II)光型射換の、波晶の配列状態の変化を示している。

特別甲3-36527(プ)

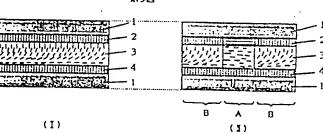
関中、符号1は基板、2は光により可逆的な構 遊覧化を起こす高分子屋、3は被品層、4はホモ ジニアス配向屋である。また人は露光部分、13は 水質光部分を示す。

ងរដ

at 2 (3



M313



特許出題人 工業技術院長 杉 雄 實 指定代理人 工業技術院維維實分子材料研究所及 類 田 呂 切